

СКАНИРУЮЩАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ СИЛЫ МЕЖАТОМНОГО ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ

С.И. Васильев, В.Б. Леонов,
Ю.Н. Моисеев, В.И. Панов

При изучении рельефа поверхности изолирующих веществ до недавнего времени использовались контактные, оптические или емкостные профилометры [1, 2], которые обладают невысоким продольным разрешением $4 \sim 1000 - 5000 \text{ \AA}$. Однако, для решения многих задач физики поверхности и микроэлектроники требуется производить детальный анализ локальных микроскопических характеристик поверхности диэлектриков в атомных масштабах, включая распределение микронеоднородностей, заряженных и нейтральных дефектов, дислокаций и др. Для этих целей в работе [3] было предложено использовать силы межатомного (межмолекулярного) взаимодействия, возникающие между исследуемой поверхностью и подносимым к ней на расстояние $\sim (1-10^2) \text{ \AA}$ острием. Первые эксперименты такого рода с использованием нового метода (атомной силовой микроскопии (АСМ)) [3, 4] продемонстрировали возможность получения информации о состоянии поверхности проводящих и диэлектрических веществ с разрешением, приближающимся к разрешению сканирующих тунNELьных микроскопов (СТМ) [5], которые не могут использоваться для исследования поверхности диэлектриков.

В настоящем сообщении кратко изложена методика исследования микрорельефа поверхности, основанная на применении межатомных силовых взаимодействий. Измерения проводились по схеме, описанной в [3] и показанной на рис. 1. В этой схеме основным элементом служит диэлектрическое, либо проводящее острие 1, к которому с помощью трехкоординатного пьезоманипулятора 2 подводится поверхность исследуемого образца 3. Острие закреплено на пружине 4, изготовленной в виде кронштейна с малой механической жесткостью K_μ . С противоположной стороны кронштейна к нему подведено проводящее острие 5 иглы тунNELьного микроскопа, используемое для регистрации механических перемещений или колебаний кронштейна. В результате приближение поверхности образца к острию вызывает отклонение кронштейна от положения равновесия на величину $d(z) = F(z)/K_\mu$ и изменяет его собственную частоту ω_μ вследствие нелинейной зависимости от расстояния сил взаимодействия $F(z)$. Вариации d и ω_μ , преобразованные в электрический сигнал обратной связи, управляют перемещением образца, удерживая его поверхность при помощи пьезоманипулятора на расстоянии z (F) от острия в процессе сканирования.

В данной работе использовался АСМ, который был создан на базе ранее описанного в [6] сканирующего тунNELьного микроскопа. Зондирующее острие АСМ радиусом $R \lesssim 0,3 \text{ мкм}$, изготовленное из монокристалла Al_2O_3 , было закреплено на металлизированном

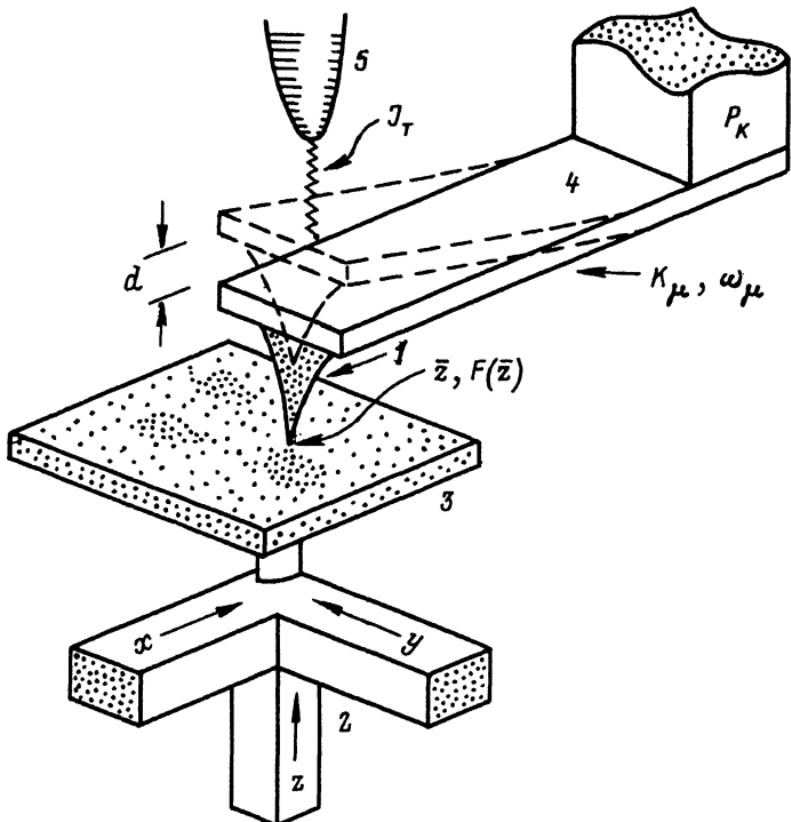


Рис. 1. Схема работы атомного силового микроскопа.

1 – зондирующее острие, 2 – пьезоманипулятор, перемещающий образец, 3 – образец, 4 – пружинящий кронштейн, 5 – проводящее острие туннельного датчика смещений.

кварцевом кронштейне длиной 1 мм и диаметром 30 мкм. Его механическая жесткость $K_{\mu} \approx 30 \text{ Н/м}$ частота собственных колебаний $\omega_{\mu} \approx 9 \text{ кГц}$ и добротность $Q_{\mu} \approx 250$. При этих параметрах ACM дает возможность регистрировать величину силы $\delta F \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{ Н}$, что значительно превышает предельное значение $F_{\phi} \approx 5 \cdot 10^{-12} \text{ Н}$, получаемое из оценки термодинамических флуктуаций, действующих на кварцевый кронштейн. Такая чувствительность к силе позволяет реализовать продольное разрешение ACM в пределах десяти ангстрем в воздушной среде. (Следует отметить, что наличие жидкого адсорбата на поверхности повышает пространственное разрешение ACM [4], но приводит к изменению ее микроскопических характеристик.)

С помощью ACM была исследована структура поверхности моноокристалла лейкосапфира (Al_2O_3), сколотого вдоль плоскости спайности $\{10\bar{1}1\}$ (плоскость морфологического ромбоэдра).

На рис. 2,а приведено изображение одного из участков поверхности скола, полученного в воздушной среде. Кадр размером $280 \text{ \AA} \times 280 \text{ \AA}$ снят при скорости сканирования $v_s = 1 \text{ строк/с}$. Структурные неоднородности, наблюдаемые в виде цепочек пиков шириной

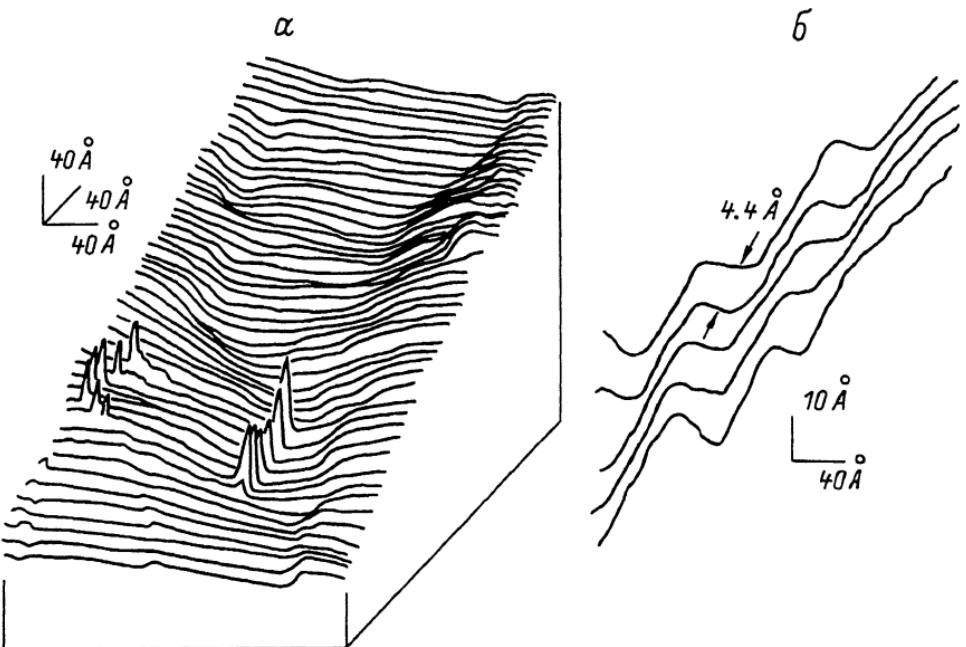


Рис. 2.

$\sim 10 \text{ \AA}$ и длиной $(50-80) \text{ \AA}$, по-видимому, связаны с изменением характера силового взаимодействия острия с поверхностью в местах локализации линейных дефектов. Это находит подтверждение в резких вариациях величины ω_μ кронштейна над этими участками поверхности. (Анализ физических результатов и их интерпретация будут опубликованы в подробной статье). На рис. 2,б дана запись нескольких строк изображения рельефа, полученных сканированием вдоль участка поверхности скола с неоднородным рельефом. Расстояние между строками $\delta y = 4.4 \text{ \AA}$. Из записей можно оценить пространственное разрешение, которое реализуется на данной модели АСМ. В направлении нормали к поверхности оно соответствует уровню шумовой амплитуды, которая для приведенных записей не превышает $\delta z \approx (1-3) \text{ \AA}$. Достоверную оценку продольного разрешения Δ получить сложнее, поскольку для этого требуется исследовать участок поверхности с заранее известным рельефом. Из рис. 2,а,б следует, что в этой серии измерений величина Δ была не хуже $(10-15) \text{ \AA}$.

Полученное разрешение АСМ определяется радиусом зондирующего острия и тем расстоянием \bar{z} , на которое конец острия приближен к поверхности. На расстояниях порядка единиц ангстрем между острием и поверхностью действуют, в основном, экспоненциально спадающие с расстоянием силы $\sim (10^{-6}-10^{-7}) \text{ Н}$, и основное силовое взаимодействие осуществляется лишь с той частью атомов острия, которые наиболее близко расположены к исследуемой поверхности. В этом случае продольное разрешение может достигать еди-

ниц ангстрем [7]. С ростом \bar{z} основной вклад в работу АСМ начинают давать взаимодействия с энергией $E \sim (10^{-1}-10^{-2})$ эВ, имеющие степенную зависимость от расстояния. Это приводит к уменьшению абсолютного значения $F(z)$, увеличению размеров области взаимодействия острия с поверхностью и в результате вызывает ухудшение продольного разрешения Δ .

Представленные выше результаты получены для промежуточной области расстояний между острием и поверхностью, что связано с относительно большой жесткостью кронштейна. Кроме того, смещения кронштейна регистрировались туннельным датчиком перемещений с чувствительностью $\approx 10^{-1}$ Å в полосе частот 0.5 кГц [6]. Уменьшение жесткости K_{μ} при сохранении ω_{μ} и переход от туннельного к оптическим, либо емкостным датчикам, способным регистрировать перемещения до $\sim (10^{-18}-10^{-19})$ м [8], дают возможность повысить разрешение АСМ в направлении нормали к поверхности.

Резюмируя сказанное, следует обратить внимание на тот факт, что метод АСМ применим (в отличие от СТМ) для бесконтактного исследования микрорельефа поверхностей любых веществ (диэлектриков, полупроводников и металлов) и позволяет изучать локальные межатомные (межмолекулярные) взаимодействия с атомным пространственным разрешением. Совместное применение этих методов даст наибольшую информацию о состоянии и физико-химических свойствах исследуемой поверхности.

Авторы благодарят Л.В. Келдыша за поддержку работы, Ю.С.Бараша и Г.И. Салистру за стимулирующие дискуссии.

Л и т е р а т у р а

- [1] G v e n t h e r K.H., W i e r e r P.G., B e n n e t t J.M. - Appl. Opt., 1984, v. 23, p. 3820-3836.
- [2] M a t e y J.R., B l a n c J. - J. Appl. Phys., 1985, v. 57, p. 1437-1444.
- [3] B i n n i n g G., G e r b e r Ch., Q u a t e C.F. - Phys. Rev. Lett., 1986, v. 56, p. 930-933.
- [4] M a r t i O., D r a k e B., H a n s - m a P.K. - Appl. Phys. Lett., 1987, v. 51, N 7, p. 484-486.
- [5] B i n n i n g G., R o h r e r H. - J. Res. Develop., 1986, v. 30, N 4, p. 355-369.
- [6] В а с и л ѿ в С.И., Л е о н о в В.Б., П а н о в В.И. - Письма в ЖТФ, 1987, т. 13, в. 15, с. 937-941.
- [7] A l b r e c h t T.R., Q u a t e C.F. - J. Appl. Phys., 1987, v. 62, N 7, p. 2599-2602.

[8] Брагинский В.Б., Панов В.И., Попель -
нюк В.Д. - Письма в ЖЭТФ, 1981, т. 33, с. 423-425.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
30 ноября 1987 г.
В окончательной редакции
21 января 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 8

26 апреля 1988 г.

СВЧ-ГАШЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ В $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$

Б.А. Акимов, Н.Б. Брандт,
Д.Р. Хоклов, С.Н. Чесноков

Обнаружение эффекта остаточной фотопроводимости (ОФП) в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ [1] открывает большие перспективы для их использования в качестве счетчиков фотонов далекого ИК-диапазона. Однако существование долговременной фотопамяти в $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ приводит и к возникновению значительных трудностей при попытках применить указанные материалы как базовые элементы приемных ИК-систем. Методы теплового [1] и контактного электротермического [2] гашения ОФП не являются удовлетворительными в силу их большой инерционности (характерное время гашения $\approx 10^{-3}$ с). Электронный механизм [3] обеспечивает гашение ОФП за $\sim 10^{-7}$ с, однако оно является неполным и неоднородным по образцу и связано с формированием домена сильного поля.

В настоящей работе описан новый бесконтактный метод гашения ОФП в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ с помощью импульса СВЧ.

В качестве рабочего материала использовались монокристаллы $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te + 0.5$ ат.% In , находящиеся в диэлектрическом состоянии [4] при низких температурах. Образец помещался внутрь индуктивности колебательного контура, на который периодически подавались прямоугольные импульсы СВЧ длительностью ΔT от 10^{-6} до 10^{-1} с. Частота СВЧ-колебаний в импульсе составляла ~ 400 МГц. ИК-подсветка образца осуществлялась с помощью теплового источника излучения, нагреваемого до температур $10 \text{ K} \leq T^* \leq 300 \text{ K}$. Измерения проводились в охлаждаемой жидким гелием вакуумируемой металлической камере, полностью экранирующей образец от фонового излучения.

Установлено, что для каждой фиксированной температуры источника ИК-излучения T^* и мощности в СВЧ-импульсе P существует характерная длительность импульса ΔT_0 такая, что при $\Delta T > \Delta T_0$ происходит стабильное и полное гашение ОФП, а если $\Delta T < \Delta T_0$, то гашение становится нестабильным, и образец постепенно переходит